DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04900266 ** Image available **

ORGANIC THIN FILM TYPE ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

PUB. NO.:

07-192866 [JP 7192866 A]

PUBLISHED:

July 28, 1995 (19950728)

INVENTOR(s): SAKON HIROTA

NAGAI KAZUKIYO

ADACHI CHIHAYA

TAMOTO NOZOMI

APPLICANT(s): RICOH CO LTD [000674] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

05-348219 [JP 93348219]

FILED:

December 26, 1993 (19931226)

INTL CLASS:

[6] H05B-033/04

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 44.9 (COMMUNICATION --

Other)

JAPIO KEYWORD: ROO3 (ELECTRON BEAM)

ABSTRACT

To prevent the intrusion of moisture, and to provide an PURPOSE: electroluminescent element, in which the generation of dark spot is reduced and which has the excellent durability, by containing at least one kind of each organic compound layer structural component and inorganic oxide in a sealing protecting layer of a laminated product.

CONSTITUTION: A stripe positive electrode pattern 2 at 2mm of width made of 1TO is formed on a glass substrate 1, and a hole transporting layer 3 at 500 angstroms of thickness and a light emitting layer 4 at 500 angstroms of thickness are laminated by the deposition. Next, a negative electrode 5a at 3000 angstroms of film thickness is deposited with a pattern, which crosses the positive electrode 2. Finally, as a sealing protecting layer 6, the organic compound used for the light emitting layer 4 and GeO as the inorganic oxide are deposited together at 1:6 of ratio and laminated at 3500 angstroms of thickness to form an electroluminescent element. In this element, the reduction of the light emitting area due to the generation of dark spot is not recognized after passing one month from the manufacture, and the durability is improved.

(11)特許出願公開番号

特開平7-192866

(43)公開日 平成7年(1995)7月28日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H05B 33/04

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全5頁)

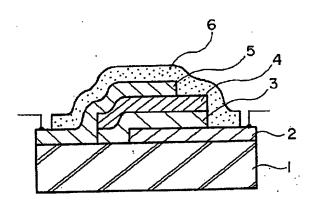
(21)出願番号	特願平5-348219	(71)出願人 000006747 株式会社リコー	
(22) 出願日	平成5年(1993)12月26日	東京都大田区中馬込1丁目3 (72)発明者 左近 洋太東京都大田区中馬込1丁目3	
		会社リコー内 (72)発明者 永井 一清 東京都大田区中馬込1丁目3	番6号 株式
		会社リコー内 (72)発明者 安達 千波矢 東京都大田区中馬込1丁目3	番6号 株式
		会社リコー内 (74)代理人 弁理士 池浦 敏明 (外1	名) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機薄膜型電界発光素子

(57)【要約】

【構成】 基板上に陽極及び陰極とこれらの間に挟持された一層又は複数層の有機化合物層より構成される積層体を配置した有機薄膜電界発光素子において、該積層体を保護するように封止保護層が設けられ、その封止保護層が構成成分として有機化合物層構成成分の少なくとも1種と無機酸化物を少なくとも含有することを特徴とする有機薄膜型電界発光素子。

【効果】 本発明の電界発光素子は、特有な封止保護層を設けたことから、電界発光素子を外界の水分等から良好に遮断保護することができるから、ダークスポット等の劣化のない耐久性の著しく優れたものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に陽極及び陰極とこれらの間に挟 持された一層又は複数層の有機化合物層より構成される 積層体を配置した有機薄膜型電界発光素子において、該 積層体を保護するように封止保護層が設けられ、その封 止保護層が構成成分として有機化合物層構成成分の少な くとも1種と無機酸化物を少なくとも含有することを特 徴とする有機薄膜型電界発光素子。

【請求項2】 封止保護層構成成分である無機酸化物が 一酸化ゲルマニウムであることを特徴とする請求項1の 10 4-212284号)。しかしながら、未だ満足するも 有機薄膜型電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電界の印加によって発光 する、有機薄膜型電界発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】電気信号に応答して多色表示するカラー 表示装置として、近年、完全固体型として高輝度の発光 が得られる有機薄膜型電界発光素子が開発され、各種の 表示装置における発光素子として注目されている。この 20 有機薄膜型電界発光素子は、有機物質を原料としている ため、それを構成する材料も多種の材料から選択しうる こと、完全固体型であるため耐衝撃性に優れているこ と、低電圧の印加で発光しうること、高輝度高効率の発 光が得られること、更に、多色表示が可能である等、優 れた特性を有しており、それを構成する材料、構造等の 研究が盛んに行なわれている。

【0003】有機薄膜型電界発光素子としては、その構 造として、陰極/発光層/正孔輸送層/陽極、陰極/電 子輸送層/発光層/陽極、陰極/電子輸送層/発光層/ 30 正孔輸送層/陽極、等の構成のものが開発されている。 具体的には、例えば、透明基板上に、複数の透明陽極、 必要により正孔輸送層、発光層、必要により電子輸送 層、前記透明電極に交差する複数の背面陰極を、順に積 層したものである。

【0004】正孔輸送層は、陽極からの正孔を注入させ 易くする機能と、電子をプロックする機能とを有し、一 方電子輸送層は陰極からの電子を注入させ易くする機能 を有している。発光層において、一対の電極から注入さ れた電子と正孔との再結合によって励起子が生じ、この 40 励起子が放射失活する過程で光を放ち、この光が透明電 極及び透明基板を介して外部に放出され、表示が可能と なる。

【0005】このような有機薄膜型電界発光素子におい て、素子の高精細化のために電極パターンを微細化する ことが望まれており、電極間に層間絶縁膜を形成し、発 光の均一性を保持し、パターン精度を向上させたものが 提案されている(特開平3-250583号)。また有 機化合物層と電極間に絶縁層を形成し、パターン精度及

3-274694号)。更にまた、電極の縁部に絶縁層 を形成し、クロストークや発光のにじみを減少させたも のも提案されている(特開平4-51494号)。

【0006】更に、これらの有機薄膜型電界発光素子は 外界からの水分の侵入等によって、耐久性低下の原因と なるダークスポットと呼ばれる非発光部が多発するた め、その表面に封止保護層を設けることが数多く提案さ れている(例えば、特開平4-233192号、特開平 4-206386号、特開平4-79194号、特開平 のが得られていないのが現状である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる事情 に鑑み、外界からの水分等の侵入を防止し、ダークスポ ットの発生が少なく、耐久性に優れた電界発光素子を提 供することを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、第1 に、基板上に陽極及び陰極とこれらの間に挟持された一 層又は複数層の有機化合物層より構成される積層体を配 置した有機薄膜型電界発光素子において、該積層体を保 護するように封止保護層が設けられ、その封止保護層が 構成成分として有機化合物層構成成分の少なくとも1種 と無機酸化物を少なくとも1種含有することを特徴とす る有機薄膜型電界発光素子が提供され、第2に、封止保 護層構成成分である無機酸化物が一酸化ゲルマニウムで あることを特徴とする上記有機薄膜型電界発光素子が提 供される。

【0009】以下、本発明を図面に沿って説明する。図 において、1はガラス基板、2は陽極、3は正孔輸送 層、4は発光層、5は陰極、6は封止保護層である。

【0010】本発明に係る封止保護層6は前記したよう に、有機化合物層構成成分の少なくとも1種と無機酸化 物を少なくとも1種を主成分とする。

【0011】有機化合物層の構成成分の少なくとも1種 としては、後記する発光層、正孔輸送層、電子輸送層等 の主成分となる有機化合物がそのまま使用できるが、電 極をはさんで封止保護層に最も近い層の有機化合物層の 構成成分がより好ましく、これらを用いることにより、 耐久性が更に向上した電界発光素子が得られる。

【0012】無機酸化物としては、CeO₁、Cr O, MgO, MoO, SiO, SiO, TiO, T iOx、GeO等が挙げられるが、好ましいのはGeO (一酸化ゲルマニウム) である。

【0013】封止保護層の作成は蒸着法、溶液塗布法等 の良好な膜形成法であれば任意の形成法を利用できる。 例えば蒸着法の場合には多元蒸着法により所望の形態で 作製が可能であり、溶液塗布法では所望の割合で塗布液 を調整して成膜することができる。封止保護層の緻密性 び表示品質を向上させたものも提案されている(特開平 50 や素子作製時の積層容易性等から蒸着法が好ましく、ま 3

た抵抗加熱による蒸発が困難な無機酸化物を用いる場合には電子ビーム蒸着法等を利用するのが好ましい。封止保護層の膜厚は任意であるが、保護層の機能の発現性からみて500Å以上好ましくは1000Å以上であることがより好ましい。

【0014】本発明による封止保護層が優れている理由としては、次のようなことが考えられる。素子に封止保護層を設ける場合、封止保護層は金属である陰極と、陰極の形成されていない部分では有機化合物層と接することになり、2種類の性質の異なる物質と接する。本発明10による封止保護層は、無機酸化物と有機化合物層構成成分の両方を成分として含有している為、陰極と有機化合物層の双方との接着性、密着性が良好な状態となっていると考えられ、結果的にダークスポットの抑制等に効果を有する封止保護層が得られたものと推定される。

[0015]次に、本発明の他の構成要素について説明する。有機化合物を構成成分とする層としては、例えば発光層、正孔輸送性化合物と電子輸送性化合物との組合せになる発光層、正孔輸送層、電子輸送層等が挙げられ、有機化合物としては従来公知のものがいずれも使用できる。以下、その具体例を示す。

【0016】正孔輸送能を有する電子供与性有機化合物としては、ポリビニルカルバゾールのような正孔輸送能に優れた高分子化合物や正孔輸送能に優れた低分子化合物が挙げられる。低分子化合物の例としては、トリフェニルアミン類、スチルベン誘導体類、オキサジアゾール類等が挙げられ、その具体例としては、例えば以下のようなものが例示される。

[0017]

【表1】

【0018】発光性有機化合物としては、電子輸送性または正孔輸送性を持ち、固体状態で強い蛍光を発する物質を用いる。電子輸送性の物質としては例えば、ペリノン誘導体、、キノリン錯体誘導体が挙げられるが、その具体例としては次のような物質等を挙げることができる。

【表2】

[0019]

【0020】正孔輸送性の物質としては例えば、トリフ ェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、トリフ ェニルアミン誘導体が挙げられるが、その具体例として は次のような物質等を挙げることができる。

[0021]

【表3】

$$NC-\bigcirc -CH=CH-\bigcirc -CH=CH-\bigcirc -CH$$

$$C=CH-\bigcirc -N-\bigcirc -CH=CH-\bigcirc -N-\bigcirc -OCH_s$$

$$CH_s$$

$$CH_s$$

$$CH=CH\bigcirc -N-\bigcirc -CH=CH\bigcirc -N-\bigcirc -CH_s$$

【0022】発光層は、正孔輸送性、電子輸送性、発光 特性を有する化合物を各々単独で用いた単層、あるいは 正孔輸送性化合物、発光性化合物あるいは電子輸送性化 合物の組合せによりなる多層で形成されていてもよい。

【0023】陽極2としては金、白金、パラジウムなど の金属の蒸着、スパッタ膜あるいはスズ、インジウムー 30 スズの酸化薄膜(ITO)等で形成され、発光を取り出 すため、400nm以上の波長領域で透明であることが 望ましい。

【0024】陽極4は、金属の真空蒸着により前記発光 層上に形成されるが、その材質としては真空蒸着可能な あらゆる金属が使用され得るが、仕事関数が小さい金 属、特にMg、Al、Ag、In、Sn、Pb、Mn、 あるいはこれらの合金を用いることが望ましい。

[0025]

【実施例】つぎに、本発明を実施例により更に詳細に説 40 明する。

【0026】実施例1

ITOより成る2mm幅のストライプ状陽極パターンを 形成したガラス基板を用い、図1に示すように正孔輸送 層500人、発光層500人を蒸着して積層した。な お、正孔輸送層、発光層に用いた有機化合物は各々下記 に示す〔化1〕、〔化2〕である。次にMgCu合金 (Mg:Cu=10:1) より成る陰極を2mm幅でI T〇陽極パターンと交差するように膜厚3000点で蒸 着した。最後に封止保護層として〔化2〕とGeOを

1:6 (成膜速度比)で共蒸着により膜厚3500Åで 積層し電界発光素子を作製した。以上のようにして作製 した素子は、素子作製1カ月後においても、ダークスポ ットによる発光領域の減少は認められず耐久性に優れた 素子であった。

【化1】

【化2】

$$(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$$
).

【0027】実施例2

発光層に使用する有機化合物を下記 (化3)に示す化合 物とし、封止保護層を〔化3〕で示される化合物とSi 〇を1:4 (成膜速度比)で共蒸着した以外は実施例1 と同様にして作製した。この素子は、素子作製1カ月後 においても、ダークスポットによる発光領域の減少は認 められず耐久性に優れた素子であった。

[化3]

50

【0028】比較例

封止保護層をSiOのみで構成した以外は実施例2と同様にして電界発光素子を作製した。以上のようにして作製した素子は、素子作製1カ月後において、ダークスポットによる発光領域の減少率は50%以上ともなり、陰極端部での劣化が著しいものであった。

[0029]

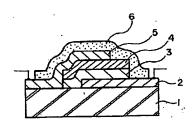
【発明の効果】本発明の電界発光素子は、前記したように特有な封止保護層を設けたことから、電界発光素子を外界の水分等から良好に遮断保護することができるので、ダークスポット等の劣化のない耐久性の著しく優れたものである。

[0030]

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る電界発光素子の模式断面図。

10 【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 田元 望

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内